

專利話廊

淺談香港地區的專利制度及注意事項

郭仁建 中國專利代理人 整理

香港地區在 1997 年回歸中國大陸之後，就施以「一國兩制」的制度，以中國大陸的一個特別行政區身份，依然保留了當時由英國殖民統治下的智慧財產權保護的機制，由於香港地區的獨特身份及專利制度屬地主義的特色，在中國大陸申請的專利申請案，並不會主動地在香港地區產生保護效果。因此，如果發明人希望自己的發明構思在香港地區受到專利保護，以制止他人在未經授權的前提下，在香港地區被製造、使用、出售或進口，或者發明人希望將此發明構思授權他人使用時，仍然必需透過香港專利制度進行專利申請。

香港地區的專利制度主要區分為三種，均為形式審查制度，各種制度的簡要描述表格如下所示：

種類 項目	標準專利	短期專利	外觀設計
保護年限	20 年，第 3 年屆滿後每年延展一次。	8 年，申請日起 4 年可延展一次，最長 8 年。	25 年，申請日起每 5 年可延展一次，最長 25 年。
保護內容	保護具新穎性和創造性的產品、物質或方法。		各種產品的外觀設計，例如物品的形狀、構形、式樣或裝飾，只要在已製成的物品上能夠吸引視線和具有肉眼可以判別的特色。
申請基礎	● 中國大陸國知局。 ● 歐洲專利局(指定英國)。 ● 英國專利局。 以上述三個專利局的發明專利案為基礎。	● 根據《專利合作條約》第 16 條委任的各個國際檢索單位。 ● 中國大陸國知局。 ● 歐洲專利局。 ● 英國專利局。 以上述的其中一個國際檢索單位或其一專利局所發出之檢索報告為基礎。	無基礎限制。
申請時限	1. 最遲在上項指定專利局之專利申請案公布後 6 個月內，提交記錄批准請求。 2. 最遲在香港公布記錄請求或指定專利案核准公告後 6 個月內（以較晚者為準），在香港提交批准請求。	無時限要求。	無時限要求。

透過上表可得知，由於香港地區曾是英國殖民地，現回歸中國大陸後，標準專利的制度可以在英國或中國大陸註冊案的基礎之上，通過記錄請求及批准請求的方式，在形式符合規範的前提下，取得長達 20 年的保護時間，但值得注意的是，應在記錄請求或者註冊與批予請求的請求期限內提交香港標準專利的申請，此期限無法延期，因此，當發明人有意願基於中國大陸或英國案的基礎上提交香港標準專利時，需特別注意此期限。

此外，在 PCT 國際申請指定中國大陸，並以中文公布的情況下，在中國大陸國知局發出「國際申請進入中國國家階段通知書」的日期起 6 個月內，或在中國大陸國知局公告該國際申請的日期後 6 個月內需提出記錄請求，並在該申請由中國大陸國知局核准公告之日起 6 個月內提交批准請求手續，否則將無法在香港地區取得專利保護；如果，在申請階段中發生錯過前述的申請時限時，則可以考慮改以香港地區的短期專利搭配主張優先權的方式來對發明進行保護，短期專利只需要在申請時提交前述表格內所載明的檢索報告，並且在符合專利要件的前提下，就能夠取得保護。

短期專利除了向香港地區提出申請，另一種方式是 PCT 國際申請指定進入中國大陸的實用新型申請案，可以在中國大陸專利申請號發出之日起 6 個月內或進入中國大陸國家階段之日起 6 個月內，向香港地區辦理短期專利的批准請求手續，等於是將中國大陸的實用新型延伸到香港地區的一種作法。

香港的外觀設計保護則是一項獨立的制度，沒有像標準專利或者短期專利的延伸制度，故在審查上也更為寬鬆，而能夠受到保護的物品如成組、成套的設計，或者符合羅卡諾分類大類 32 小類 00 的“圖形符號、標誌、表面圖案、紋飾”，並能夠就前述如“圖形符號”所應用在特定的物品上，進行外觀設計註冊；而不予保護的標的如物品的外觀不具關鍵性、違反公共秩序或道德的外觀設計、電腦程式、受保護的布圖設計（拓撲圖）以及主要屬文學或藝術性質的物品的外觀設計，也與其他國家的審查制度大同小異，例如，如臺灣開放的部分設計或 GUI 設計，目前也屬於可受到保護的標的。

綜上，香港地區基於歷史與政治發展緣故，而形成了特殊的申請制度，本文僅作粗淺介紹，以供相關從業人員有初步瞭解。

分解圖的呈現方式分享

孫紹涵

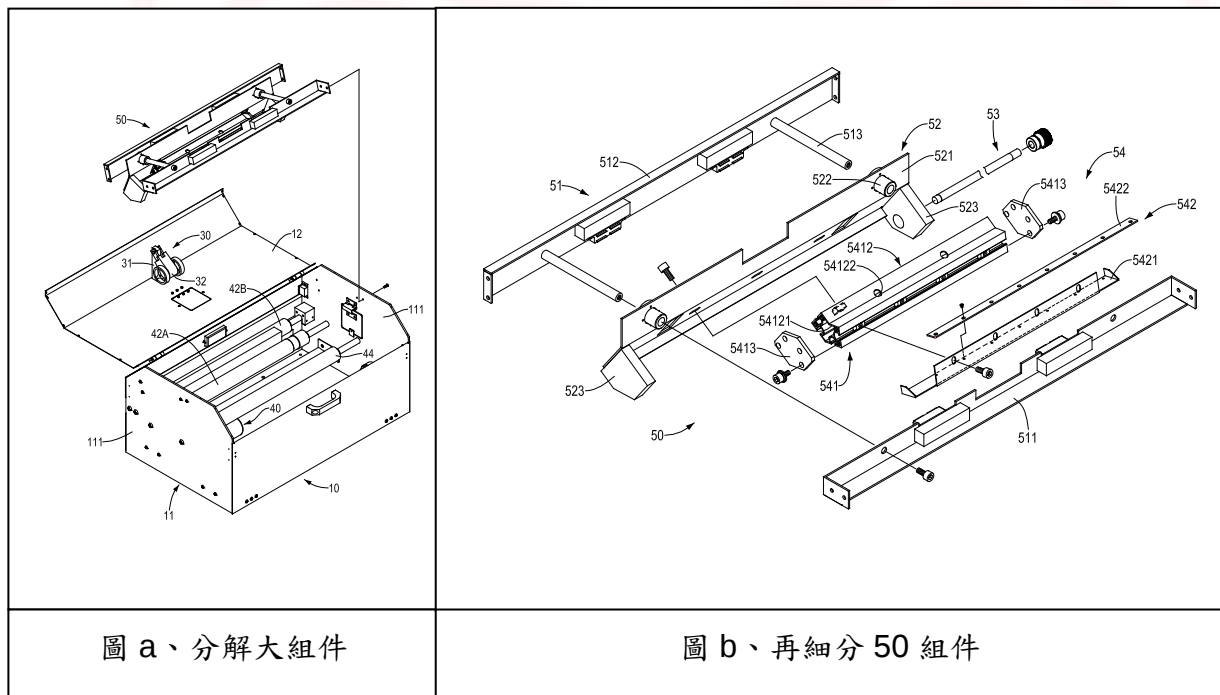
發明及新型專利圖式的配置基本型態，不外乎外觀圖、分解圖、剖面圖、動作圖及實施例圖。其中為了明確顯示申請標的物的組裝順序、零件、組件的形狀、各零件間相互關係，最適當的圖式就是以分解圖來呈現。分解圖的繪製方式如能運用得當，對於說明書之閱讀上會有相當大的幫助，能令人更容易了解創作的內容與精神。

對應專利申請標的物所需呈現的各種狀態、結構重點的不同，以下歸納出幾種分解圖呈現及處理的方法，供大家參考。

(一)立體分解

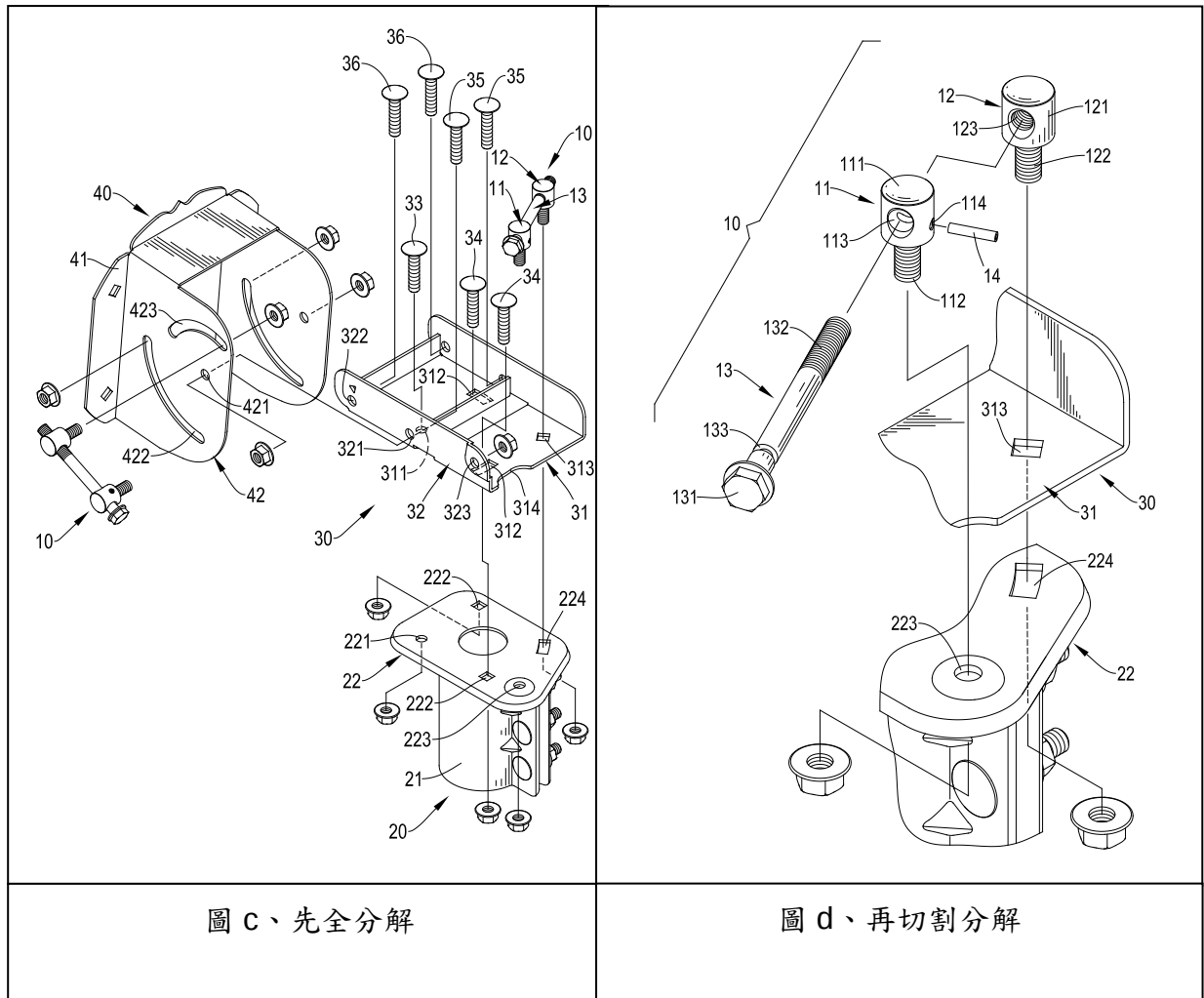
1.先分解大組件，再細分次組件

如零件分解數量過多，則必須縮小比例才能放置在一張圖中，若零件比例太小，會造成線條太密集導致輪廓形狀特徵不清楚，標註時也無法明確到位。為了避免此情形發生，建議可先分解大組件，再視本創作說明之需要細分次組件。(如圖 a、圖 b，臺灣專利號：M524262)



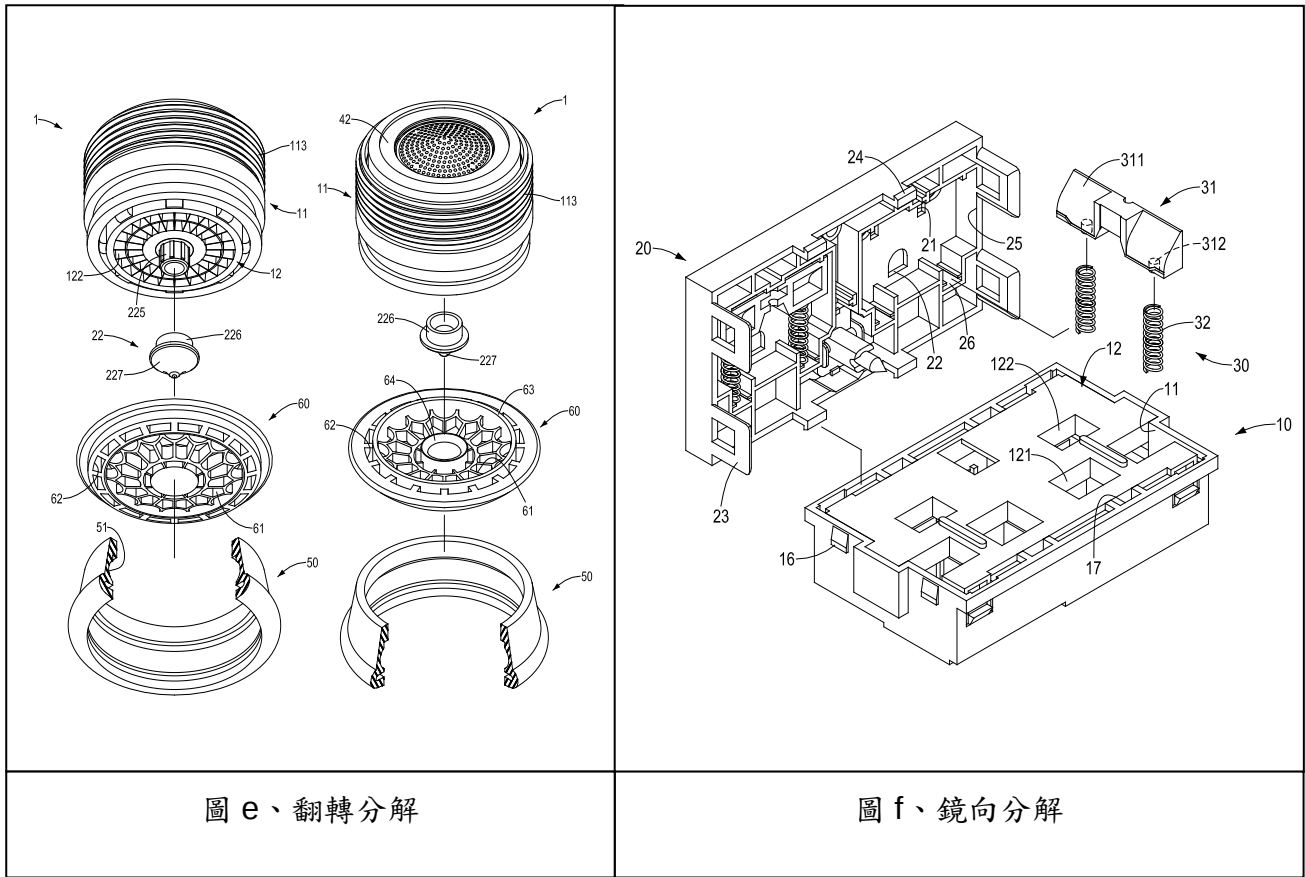
2.先全分解，再切割分解

當零組件全分解後，可能會因元件過多而限制標註的位置，而且若是勉強標註在同一張圖上，標註會過於密集而辨識不清，這時可採用切割分解圖輔助說明，也就是說從原先的整體分解圖中整理出較少構件的分解圖，使零件比例可再放大，細部結構便能清楚標註，而且標註的引線也不會太擁擠，此法是屬於較省事且有效率的變通做法。(如圖 c、圖 d，臺灣專利號：M494397)



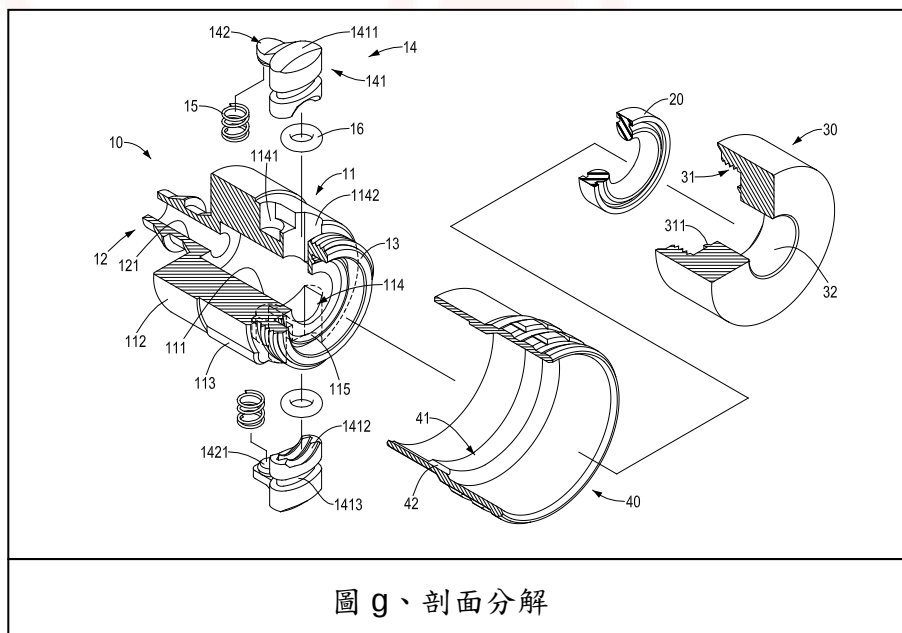
3.翻轉分解（或鏡向分解）

零組件有時結構複雜，輪廓線條多，倘若只是以虛線帶出相對應的結合位置來標註，會因輪廓線與虛線交錯重疊導致未能清楚表達標的物，此時可將原分解圖翻轉另一視角作為新的分解圖，這樣原分解圖虛線處的標註便可省略，並改標於新視角分解圖實線處。（如圖 e，臺灣專利號：I600817）。另外，亦可將零件鏡向翻轉一個角度，使原虛線處變成實線，更能清楚呈現零件結合處的相對應關係及標註。（如圖 f，臺灣專利號：M521280）



4.剖面分解:

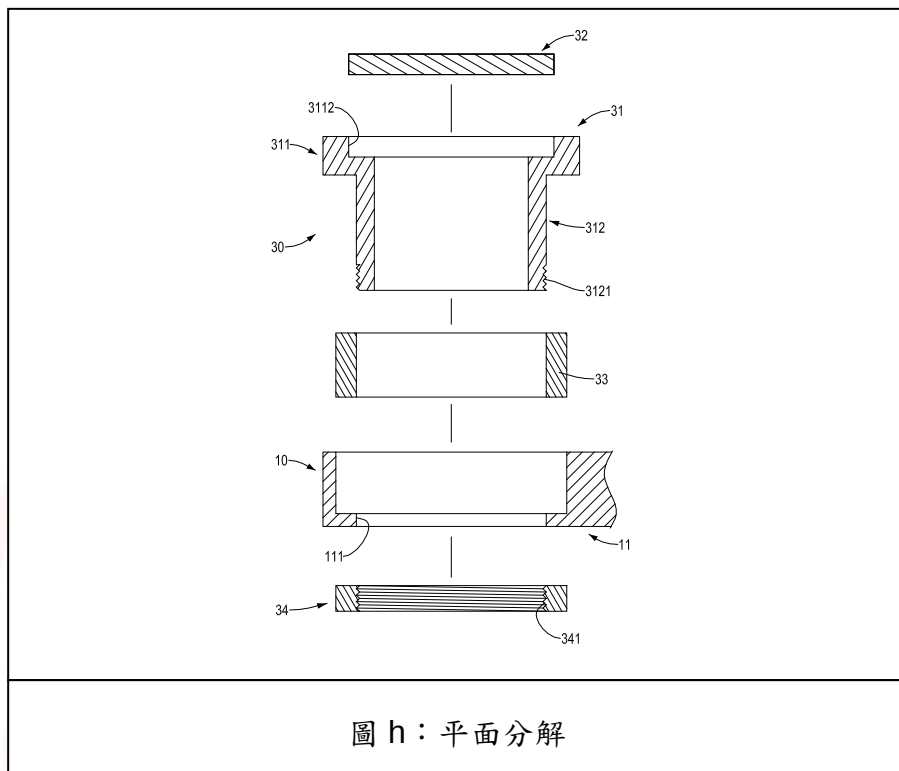
分解圖視案件內容需求，將各個零件加入剖面，使內部結構可清楚辨識，讓標號引線更能標註到位。(如圖 g，臺灣專利號：I565894)



(二)平面分解

當案件資料有限或零件外型結構單純時，亦可以平面的方式繪製分解圖。(如

圖 h，臺灣專利號：M544388)



上述分解圖的表現方法，可根據案件類型靈活運用。各種案件配置圖式時應注意結構清楚，線條清晰。在專利法施行細則當中分別也有提及發明、新型、設計應參照工程製圖方法以墨線繪製清晰，於各圖縮小至三分之二時，仍得清晰分辨圖式中各項細節。如分解圖不足以表達案件內容時，應設法用其他方式的圖面來呈現，力求簡潔且清楚地表達本創作的內容。